# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

58050790

**PUBLICATION DATE** 

25-03-83

APPLICATION DATE

19-09-81

**APPLICATION NUMBER** 

56148208

APPLICANT:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR

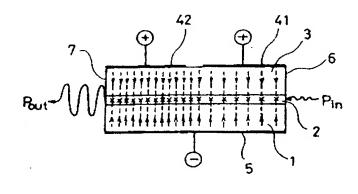
YAMANAKA KENICHI;

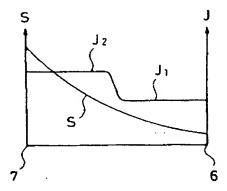
INT.CL.

H01S 3/18

TITLE

PHOTO SEMICONDUCTOR DEVICE





ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the maximum value of light output, by making the distribution of supply current densities close to one of light densities.

CONSTITUTION: Anodes 41 and 42 are split-arranged in two on the same main surface so as to set the current density  $J_2$  of the radiation side independent of the current density  $J_1$  of the incidence side. In other words, the photon density S is low on the side of incidence, and the current consumed for the amplification is also small, and therefore the current density  $J_1$  supplied from the anode 41 on the side of incidence is set at a value relatively low. Contrarily, the photo density S is high on the side of radiation, and the current density consumed for the amplification is large, and the current density  $J_2$  supplied from the anode 42 on the side of radiation is set at a value relatively high. Thereby, the excess and short of supply currents liable to be caused by conventional light amplifiers can be reduced, and thus resulting in the elimination of the saturation of amplification effects, and light output can be increased.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

3

### (9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭58-50790

(1) Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 S 3/18

識別記号

庁内整理番号 7377-5F ❸公開 昭和58年(1983)3月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

#### 60光半導体デバイス

②特 願 昭56-148208

②出 願 昭56(1981)9月19日

⑫発 明 者 髙宮三郎

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電 機株式会社エル・エス・アイ研 究所内

**⑩発 明 者 堀内茂樹 🥍** 

伊丹市瑞原 4 丁目 I 番地三菱電 機株式会社エル・エス・アイ研 究所内

明 細 傷

### 1. 発明の名称

光半導体デバイス

#### 2 特許請求の範囲

それぞれの主面上に電極を設けた各別の導電性の半導体領域と、これらの各半導体領域間にストライプ状に形成された活性領域と、ストライプに直交する1対になつた入射側,出射領域面あるいは共振域面とを値えた光増巾器あるいはレーザダイオードにおいて、前配同一主面上に設けられる一方の電極を、各端面間で複数個に分割し、この分割された各電極の電流値を制御するようにしたことを特数とする光半導体デバイス。

#### 3 発明の詳細な説明

との発明は光半導体デバイス, 特化レーザダイ オードあるいは光増巾器として用いる光半導体デ パイスに関するものである。

近年レーザダイオードの鏡面反射率を零化近付 けた構造を光の進行波増巾器として用いることが 検討されている。従来のこの種の光増巾器の構造 ⑫発 明 者 大滝要

伊丹市瑞原4丁目1番地三菱電 機株式会社エル・エス・アイ研 究所内

70発 明 者 山中憲一

伊丹市瑞原4丁目1番地三菱電 機株式会社エル・エス・アイ研 2005年

究所内

切出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2 番3号

個代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

を第1図(4)・(4)に示してある。 すなわち・第1図(4)は倒断面・同図(4)は平断面をそれぞれにあらわしてあり、 これらの各図において、(1)は n 形半導体領域、(2)はストライプ状活性領域、(3)は P 形半導体領域を示し、また(4)は陽循電極、(5)は陰極電極で、(6)と(7)とはそれぞれに反射率を等に近付けた弾面である。

しかしてこの構造にあつて、順方向バイアスを印加すると、符号(8)と(9)で示すように正孔と電子が流れ、これが活性領域(2)の中で(2)印のとかり発光再結合する。そこで入射倒端面(6)から入射光(Pin)を導入することにより、出射倒端面(7)から増巾された出射光(Pout)を取出すのである。すなわち、通常の熱平衡状態にあつて半導体は入射光(Pin)を吸収してしまうが、正孔(8)と電子(9)の生入量が多く、活性領域(2)内での正孔(8)かよび電子(9)のエネルギー分布が、いわゆる分布反転状数になると、この入射光(Pin)は吸収されずに、同関(b)にみられるとかり伝播しなから増巾され、大まな出射光(Pout)となつて取出されることにな

持開昭58-50790(2)

る。ことで実際には、分布反転で大小関係が決まる時場放出と時場数似のほかに、フリーキャリャによる光の吸収、および回析とか飲品により活性 領域(2)から外れて失われてゆくことによる光損失 も存在するから、この光損失と時場吸収による損失 失を上題る誘導放出が起るときに、光の増巾がな されることになるのである。

従来の光増巾器にあつては、向図(s)に示したよりに、1つの主面上に形成される質値・例えば(4)が1個であつて、これが光の入射側端面(6)から出射側端面(7)に亘つて一様を密度で電産を供給していた。ところがことで注入されるキャリャの消費の速さは、

$$\frac{f_n}{f_t} = C_1(n-no)S + \frac{n}{r_s}$$
 • • • • • (1) 但し、n: キャリャ密度

t : 時間

Cı:比例定数

10:誘導放出と誘導吸収が均衡するキャ

・リヤ密度

9: 光子密度

の全長に亘つて1つの主面上に1つの電極を形成して、一様な電流を供給する構造の場合には、同様にその中央部(1)ではキャリャが過剰気味となり、各端面(6)、(7)の近傍では不足気味となる。そしてこの端面近傍でのキャリャ不足は、端面にむける再結合中心による非発光再結合の影響と併せて光吸収の原因となり易く、結果的に出力の最大値を制限するものであつた。

このように従来の光増巾器とかレーザダイオードにおいては、供給される電流密度の分布と光密度の布とのバランスがとれていないために、キャリャ密度が過剰な部分と不足な部分とを生じ、不足部分では増巾率の飽和や光出力数大値の抑制などの諸問題を生じていたものである。

この発明は従来のこのようを光半導体デバイス の欠点に鑑み、供給電流密度分布を光密度分布に 近付けることによつて、光出力最大値を向上させ るようにしたものである。

以下, との発明に係わる光半導体デバイスの一! 実施例につき、第3図ないし第5図を参照して詳

The second section is

▼ \*\* : キャリヤの丹結合将命 であらわすことができ、光子密度8が低い部分で はキャリヤの消費の速さは遅く、高い部分ではキャリヤの消費の速さは速くなる。すなわち・入射 倒爐面(6)に近い部分ではキャリヤの消費が遅く、 反対に出射側端面(7)に近い部分ではキャリヤの消費が速くなる。

このように従来の光増巾器では、キャリヤ(電流)の供給が入射側端面から出射側端面にかけて一様であるのに、キャリャの消費の速さは一様でないという状態にあり、このために入射側端面(6)に近い部分ではキャリャが過剰・出射側端面(7)に近い部分ではキャリャが不足となり易い。そしてこのキャリャ不足は含うまでもなく増巾率を飽和させるものであつた。

また一方、レーザダイオードの場合にないても、一般には共振嬉園の反射率が高くないために、第2回に示すように、光密度分布(II)は共振端面(6')と(7)の近得で高く、中央部で低くなつている。従つて、従来のレーザダイオードのように共振器

細に説明する。

これらの第3回ないし第5回において前記第1回(e)・(e)かよび第2回と同一符号は同一または相当部分を示している。

まず誰3回はこの発明を光増巾器に適用した場 合の一笑篇例を示しており、この実施例では階框 を符号(41)と(42)とで示したように、同一主面上 にあつて2つに分割配置させ、この構成によつて 第4回に示したように、入射側の電流密度 (Ji)に 対し出射側の電流循鎖(J2)を独立に設定し得るよ うにしたものである。すなわち、入射側では光子 密度例が低く、増巾のために預費される能流も小 さいから、入射側の随信(41)から供給する世流密 度(J1)を比較的低い値に設定し、反対に出射側で は光子密度例が高く、増巾のために消費される電 流衛度が大きいから、この出射側の陽極 (42)から 供給する循環密度 (J2)を比較的高い値に設定し、 これによつて従来の光端巾器で起りがちでもつた 供給電流の過不足を緩和し得るもので、結果的に 堆巾効果の飽和を解消して、光出力を増加させる

-382

特開昭59-50790(3)

ことができるものである。

また第5図はこの発明をレーザダイオードに適用した場合の一実施例を示しており、この実施例では共振器端面(6)から(7)にかけて、同一主面上に順次3つに分割された降極(401)、(400)、(402)を設け、各関極からそれぞれに独立して知道を印加できるようにしてある。そしてこゝでは中央部の電値(400)から供給する電流と、各端回部の電値(401)かよび(402)から供給する電流とを制御すれば、活性領域(2)に注入されるキャリヤ密度を中央部間では比較的低く、共振端面(6)かよび(7)近傍では高くでき、その結果として共振場面(6)、(7)近傍での増巾効果の始和や光吸収が超り始めるところの・光出力レベルを向上させることができるのである。

なお前配光増巾帯の場合には、陽極が2個の例を、またレーザダイオードの場合には、隔極が3 個の例をそれぞれに説明したが、これらの同一主 面上の陽極の個数をさらに多くすることによつて、

(5)・・・・除傷電電 (6)・(7)・・・・入射側、出射側降面、(6)・(7)・・・・共振端面、(8)・・・・正孔、(9)・・・・電子、(0)・・・・共振器の及さ方向中央部、(1)・・・・光子密度分布。

代型人 蕩 野 信 一(外1名)

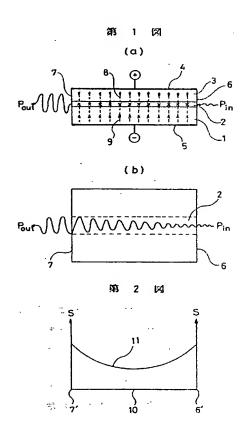
キャリャ密度分布をより一層級密に制御できることは勿論であり、また当然のこと乍ら陽低でなく、 陸橋を模数個に分割しても同様の効果を得られる ものである。

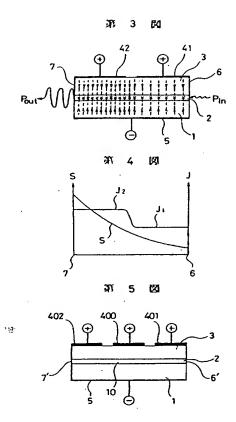
以上詳述したようにこの発明の光半導体デバイスでは、光子密度の分布に対応してデバイス内部のキャリヤ密度分布を制御することによつて、光山力限界を効果的に向上させ得る特長がある。

#### 4 図面の簡単な説明

銀1図(m), (m)は従来の光増巾器を説明するための偶断面かよび平断面図、第2図は従来のレーザダイオード内部の光子密度分布を示す脱明図、第3図はこの発明の一契施例を適用した光増市部登開するための御断面図、第4図は何上光増市内部の電流管医と光子密度分布との関係を示す歌明図、第5図はこの発明の一実施例を適用したレーザダイオードを示す側断面図である。

(1)・・・・n 形半導体領域、(2)・・・活性領域、(3)・・・ P 形半導体領域、(4) および(41), (42) ならびに(400)、(401)、(402)・・・・ 陽板電極、





(4×4・1大工事や国家の最近機能を対していたは実施していた。)(4)(5)(6×4・1大工事が国際の関係の関係を対象に対象に対していた。)